

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
 【部門区分】第7部門第2区分
 【発行日】平成21年5月21日(2009.5.21)

【公表番号】特表2007-501517(P2007-501517A)
 【公表日】平成19年1月25日(2007.1.25)
 【年通号数】公開・登録公報2007-003
 【出願番号】特願2006-522546(P2006-522546)
 【国際特許分類】

H 0 1 L 21/02 (2006.01)

G 0 5 B 19/418 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 21/02 Z

G 0 5 B 19/418 Z

【手続補正書】

【提出日】平成21年4月3日(2009.4.3)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

複数の測定サンプリング規則を生成し、
 前記複数の測定サンプリング規則の各々にサンプリング重み値を代入し、
 前記複数の測定サンプリング規則のうちの少なくとも1つに適合する加工品を少なくとも1つ識別し、

前記適合があった測定サンプリング規則の各々に対する前記サンプリング重み値を前記規則に適合する前記識別された加工品と関連付け、

前記サンプリング重み値の累計が予め決められたトリガ値に少なくとも等しい場合に測定工程を行うことを指示する方法。

【請求項2】

前記複数の測定サンプリング規則は異なるサンプリング重み値を有する請求項1記載の方法。

【請求項3】

前記複数の測定サンプリング規則のうちの少なくとも数個が同じサンプリング重み値を有する請求項1記載の方法。

【請求項4】

前記加工品は半導体ウェハからなるロットである請求項1記載の方法。

【請求項5】

前記測定工程は、クリティカルディメンジョン測定工程及び欠陥検査測定工程のうちの少なくとも1つである請求項1記載の方法。

【請求項6】

前記少なくとも1つの加工品は半導体製造設備内で処理が行われる請求項1記載の方法。

【請求項7】

測定工程を行うことを指示することにおいて、前記複数の測定サンプリング規則のうちの1つに対するサンプリング重み値の累計が予め決められたトリガ値に少なくとも等しい場合に測定工程を行うことを指示する請求項1記載の方法。

【請求項 8】

測定工程を行うことを指示することにおいて、前記加工品のうちの1つに対する前記サンプリング重み値の累計が予め決められたトリガ値に少なくとも等しい場合に測定工程を行うことを指示する請求項1記載の方法。

【請求項 9】

前記複数の測定サンプリング規則は、ロット状況情報及びロット履歴情報のうちの少なくとも1つに基づいている請求項4記載の方法。

【請求項 10】

さらに、前記測定工程を行うことを指示する指標がある場合に、前記サンプリング重みの前記累計を前記トリガ値の分だけ減少させる請求項1記載の方法。

【請求項 11】

さらに、前記測定工程を行うことを指示する指標がある場合に、前記サンプリング重みの前記累計を前記トリガ値の分だけ減少させて、最小値はゼロとなる請求項1記載の方法。

【請求項 12】

さらに、前記指示された測定工程を行う請求項1記載の方法。

【請求項 13】

複数の測定サンプリング規則を生成し、
前記複数の測定サンプリング規則の各々にサンプリング重み値を代入し、
前記複数の測定サンプリング規則のうちの少なくとも1つに適合する加工品を少なくとも1つ識別し、
前記適合があった測定サンプリング規則の各々に対する前記サンプリング重み値を前記規則に適合する前記識別された加工品と関連付け、
前記複数の測定サンプリング規則のうちの1つに対する前記サンプリング重み値の累計が予め決められたトリガ値に少なくとも等しい場合に測定工程を行うことを指示する方法。

【請求項 14】

複数の測定サンプリング規則を生成し、
前記複数の測定サンプリング規則の各々にサンプリング重み値を代入し、
前記複数の測定サンプリング規則のうちの少なくとも1つに適合する加工品を少なくとも1つ識別し、
前記適合があった測定サンプリング規則の各々に対する前記サンプリング重み値を前記規則に適合する前記識別された加工品と関連付け、
前記加工品のうちの1つに対する前記サンプリング重み値の累計が予め決められたトリガ値に少なくとも等しい場合に測定工程を行うことを指示する方法。